

Japanese Utility Model Publication

Patent Laid-Open No. S60-151580

Title of Utility Model: a plate holder of a rotative spreading device

Application No.: S59-41489

Application Date: March 22, S59 (1984)

What is claimed is:

1. A plate holder of a device rotatively spreading a photoregister membrane on a plate, comprising:

a depression portion formed on a top surface of the plate holder and having a same configuration and depth with that of the plate.

2. The plate holder as claimed in claim 1, wherein the depression portion has therein an adjusting device varying the depth of the depression portion depending on the depth of the plate to adjust a top surface of the plate and that of the plate holder as a same plate surface.

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 実用新案出願公開

## ⑫ 公開実用新案公報 (U) 昭60-151580

⑬ Int. Cl. 4  
B 05 C 11/08

識別記号

厅内整理番号  
7248-4F

⑭ 公開 昭和60年(1985)10月8日

審査請求 未請求 (全1頁)

## ⑮ 考案の名称 回転塗布装置の基板ホルダー

⑯ 実 須 昭59-41489

⑰ 出 須 昭59(1984)3月22日

⑱ 考案者	越川 哲生	川崎市中原区上小田中1015番地	富士通株式会社内
⑱ 考案者	寛朗	川崎市中原区上小田中1015番地	富士通株式会社内
⑱ 考案者	金井 均	川崎市中原区上小田中1015番地	富士通株式会社内
⑱ 考案者	高橋 良夫	川崎市中原区上小田中1015番地	富士通株式会社内
⑱ 考案者	畠邦夫	川崎市中原区上小田中1015番地	富士通株式会社内
⑱ 出願人	富士通株式会社	川崎市中原区上小田中1015番地	
⑱ 代理人	弁理士 井桁 貞一		

## ⑲ 実用新案登録請求の範囲

- (1) 基板にフォトトレジスト膜を回転塗布する装置における基板ホルダーであつて、その上面に基板の外形と同一形状で、かつ該基板の厚さと同一の深さの凹部を設けたことを特徴とする回転塗布装置の基板ホルダー。
- (2) 上記凹部内に、基板の厚みに応じて該凹部の深さを変え、基板上面と基板ホルダー上面とを同一平面となす調節機構を設けたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第(1)項に記載の回転塗布装置の基板ホルダー。

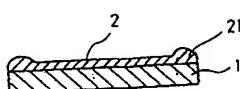
## 図面の簡単な説明

第1図は従来の基板ホルダーにより塗布したフ

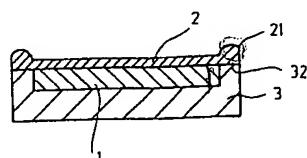
オトレジスト膜厚分布を示す図、第2図は本考案の一実施例による基板ホルダーの斜視図、第3図は本考案の基板ホルダーを使用して塗布したフォトトレジスト膜厚分布を示す断面図、第4図は基板ホルダー凹部に深さ調節機構を設けた本考案の変形実施例によるホルダーの断面図である。

図において、1は基板、2はフォトトレジスト膜、21はフォトトレジスト膜凸部、3及び4はホルダー、31及び41はホルダー凹部、32及び42はホルダー周辺部、43は基板受け台、44は調節ネジである。

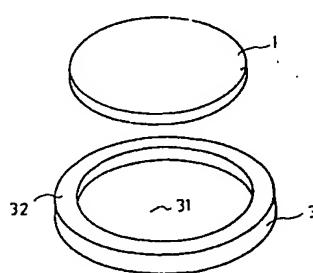
第1図



第3図



第2図



第4図

